

2026年度第3回
フォトリソデバイス・応用技術研究会



テーマ『シリコンフォトリソ』

日時：2026年10月21日(水) 13:00 ~ 17:30 (受付：12:30~)

会場：NTT 厚木研究開発センタ 1F プレゼンルーム

主催：一般財団法人光産業技術振興協会 フォトリソデバイス・応用技術研究会

協力：株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

講演プログラム (講演順、講演題名は変更される場合があります)

13:00 ~ 13:05 事務連絡・幹事挨拶

13:05 ~ 13:55

シリコンフォトリソファウンドリーの現状と展望

タワー パートナース セミコンダクター株式会社

三橋 理一郎

13:55 ~ 14:05 休憩

14:05 ~ 14:55

400G/laneに向けたSiプラットフォーム上メンブレンInP系EA-DFBレーザ

NTT株式会社

相原 卓磨

14:55 ~ 15:05 休憩

15:05 ~ 15:55

CP0用高密度ポリマー光導波路付きガラス基板

大日本印刷株式会社

北乾 巧也

16:00 ~ 17:30

ポスターセッション・名刺交換会(懇親会(無料)を同時開催します)

研究会担当幹事： NTT先端集積デバイス研究所 開 達郎
日本ルメンタム株式会社 足立 光一郎

【第3回研究会への特別聴講のご案内】

○参加費（研究会非会員1人あたり、消費税込）

- ・ 一般：18,000 円
- ・ 会員/幹事と同じ企業の紹介者：8,000円（貴社所属の会員/幹事有無はお問い合わせ下さい）
- ・ 大学関係者、学生：1,500円

○特別聴講のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.cloud.microsoft/r/7kmvgjnrYv>

特別聴講

申込フォーム



【研究会入会のご案内】

○年会費：36,000 円（年度途中入会割引あり。お問い合わせ下さい。）

- ・ 本年度残り全ての定例研究会及びワークショップにご参加いただけます。
- ・ 会員限定サービスとしてリモート聴講もご利用いただけます。

○新規入会のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.cloud.microsoft/r/2vKbvFM81T>

入会申込フォーム



【会場アクセス】

NTT 厚木研究開発センタ

〒243-0198 神奈川県厚木市森の里若宮3-1

小田急電鉄 愛甲石田駅北口からバスで約20分 / 本厚木駅東口からバスで約25分

<https://www.rd.ntt/organization/access/atsugi.html>

【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会

フォトニックデバイス・応用技術研究会 事務局（担当：野間口）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail: pdevice@oitda.or.jp

研究会ホームページ：

<https://www.oitda.or.jp/study/pd/>

研究会ホームページ



oitda フォトニックデバイス